

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分
 【発行日】平成 18 年 8 月 17 日 (2006.8.17)

【公表番号】特表 2005-534772(P2005-534772A)
 【公表日】平成 17 年 11 月 17 日 (2005.11.17)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-045
 【出願番号】特願 2004-526019(P2004-526019)
 【国際特許分類】

C 0 8 G 85/00 (2006.01)

B 0 1 J 19/00 (2006.01)

【F I】

C 0 8 G 85/00 Z C C

B 0 1 J 19/00 3 2 1

【手続補正書】
 【提出日】平成 18 年 7 月 3 日 (2006.7.3)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

材料のコンビナトリアルライブラリーを作成するための連続法であって：
 高剪断環境および脱蔵性能を有する、プラグ流れ混合装置を提供する工程、
 前記混合装置に、加熱誘起反応により変性することが可能な少なくとも 1 種のポリマーを含む組成物を前記反応器中に、連続的に導入する工程、
 前記組成物を高剪断環境に暴露させる工程、および
 変性することにより材料のコンビナトリアルライブラリーを作成することが可能な前記少なくとも 1 種のポリマーの性質に影響を与える、少なくとも 1 つの変数を導入、または経時変化させる工程、
 を含む方法。

【請求項 2】

前記組成物が、温度の影響を受けやすい少なくとも 1 種のポリマーを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記加熱誘起反応が、少なくとも 1 種の保護基を除去して、官能基を露出させる、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

前記露出された官能基が、グラフト化反応を受けることが可能である、請求項 3 に記載の方法。